

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 2 区分
 【発行日】平成 18 年 8 月 31 日 (2006.8.31)

【公開番号】特開 2001-27805 (P2001-27805A)
 【公開日】平成 13 年 1 月 30 日 (2001.1.30)
 【出願番号】特願 平 11-199096
 【国際特許分類】

G 0 3 F 7/039 (2006.01)

G 0 3 F 7/027 (2006.01)

【F I】

G 0 3 F 7/039 6 0 1

G 0 3 F 7/027 5 0 2

【手続補正書】
 【提出日】平成 18 年 7 月 13 日 (2006.7.13)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】特許請求の範囲
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 酸によりアルカリ水溶液に可溶となる樹脂および光酸発生剤を含有する化学増幅型レジスト組成物において、多官能（メタ）アクリレートを含むことを特徴とする化学増幅型レジスト組成物。

【請求項 2】 酸によりアルカリ水溶液に可溶となる樹脂が、脂環式骨格を有する単量体単位と、ラクトン骨格を有する単量体単位を含むことを特徴とする請求項 1 の化学増幅型レジスト組成物。

【請求項 3】 請求項 2 記載の化学増幅型レジスト組成物を用いてレジストを形成し、ドライエッチングを行う前にレジストに活性光線の照射および / または遠赤外線もしくは熱源による加熱処理を行うことを特徴とするレジストパターン形成方法。

【手続補正 2】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 1 0
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 1 0】

また、本発明は、この化学増幅型レジスト組成物を用いてレジストを形成し、ドライエッチングを行う前にレジストに活性光線の照射および / または遠赤外線もしくは熱源による加熱処理を行うことを特徴とするレジストパターン形成方法である。

【手続補正 3】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 4 1
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 4 1】

次に、本発明の化学増幅型レジスト組成物の使用方法について説明する。化学増幅型レジスト組成物を用いてパターン形成したレジストに対して、ドライエッチングを行う前に UV, DUV, EB 等の活性光線の照射および / または遠赤外線もしくはホットプレート等の熱源により一定時間加熱処理を行うことが好ましい。